

特 許 協 力 条 約

発信人：日本国特許庁（国際調査機関）

あて先 西澤 和純 様 〒100-6620 日本国 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号	<h2 style="margin: 0;">P C T</h2> <p style="margin: 5px 0;">国際調査機関の見解書</p> <p style="margin: 5px 0;">(法施行規則第40条の2) [P C T 規則43の2.1]</p>	
出願人又は代理人の書類記号 PC-28454	発送日 (日.月.年) 04.02.2020	
国際出願番号 PCT/JP2019/046385	国際出願日 (日.月.年) 27.11.2019	優先日 (日.月.年) 05.12.2018
国際特許分類 (I P C) H01L 23/00(2006.01)i; H01L 21/301(2006.01)i FI: H01L21/78 M; H01L23/00 C		
出願人 (氏名又は名称) リンテック株式会社		

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の単一性の欠如
- 第V欄 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の欠陥
- 第VIII欄 国際出願についての意見

2. 今後の手続

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	見解書を作成した日 22.01.2020	権限のある職員（特許庁審査官） 中田 剛史 50 2951 電話番号 03-3581-1101 内線 3559
--	-------------------------	---

第 I 欄

見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

- 出願時の言語による国際出願
 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文（PCT規則12.3(a)及び23.1(b)）

2. この見解書は、PCT規則91の規定により国際調査機関が許可した又は国際調査機関に通知された明らかな誤りの訂正を考慮して作成した（PCT規則43の2.1(b)）。

3. この国際出願で開示されたヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下の配列表に基づき見解書を作成した。

a. 出願時における国際出願の一部を構成する配列表

附属書C/ST.25テキストファイル形式

紙形式又はイメージファイル形式

b. 国際出願とともに、PCT規則13の3.1(a)に基づき国際調査のためにのみ提出された、附属書C/ST.25テキストファイル形式の配列表

c. 国際出願日後に、国際調査のためにのみ提出された配列表

附属書C/ST.25テキストファイル形式（PCT規則13の3.1(a)）

紙形式又はイメージファイル形式（PCT規則13の3.1(b)及びPCT実施細則第713号）

4. さらに、複数の版の配列表又は配列表の写しが提出され、変更後の配列表又は追加の写しに記載された情報が、出願時における配列表と同一である旨、又は出願時における国際出願の開示の範囲を超えない旨の陳述書の提出があった。

5. 補足意見：

第V欄

新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項	1-7	有
	請求項		無
進歩性 (IS)	請求項	6	有
	請求項	1-5, 7	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求項	1-7	有
	請求項		無

2. 文献及び説明:

文献1 : WO 2017/188216 A1 (リンテック株式会社) 02.11.2017(2017-11-02)
 [0014], [0021], [0044]-[0047], [0054], [0056], [0207], [0264]-[0265]
 & CN 108884244 A
 & KR 10-2019-0003470 A
 & TW 201808606 A
 文献2 : JP 2012-214586 A (リンテック株式会社) 08.11.2012(2012-11-08)
 [0003]-[0004], [0046], [0073]-[0074] (ファミリーなし)
 文献3 : WO 2018/21145 A1 (三井化学東セロ株式会社) 01.02.2018(2018-02-01)
 [0002]-[0003], [0021], [0025], [0059], [0096], [0098], [0104]
 & US 2019/0267273 A1
 [0002]-[0006], [0074]-[0076], [0085]-[0087], [0155], [0224]-[0225], [0231]-[0233],
 [0253]
 & KR 10-2019-0021410 A
 & TW 201804531 A
 文献4 : JP 2008-280520 A (古河電気工業株式会社) 20.11.2008(2008-11-20)
 [0013] (ファミリーなし)
 文献5 : JP 2013-120839 A (リンテック株式会社) 17.06.2013(2013-06-17)
 [0120] (ファミリーなし)
 文献6 : WO 2017/150145 A1 (リンテック株式会社) 08.09.2017(2017-09-08)
 [0019]
 & CN 108778722 A
 & KR 10-2018-0120173 A
 & TW 201801916 A

請求項1、3、7に係る発明は国際調査報告で引用した文献1-3より進歩性を有さない。
 文献1には、基材及び粘着剤層の積層体である支持シートと、支持シートの一方の表面上に積層された保護膜形成用フィルムとを備えた保護膜形成用複合シート及び当該シートを用いた半導体チップの製造方法であって、基材は帯電防止コート層を有し、保護膜形成用フィルム上には剥離フィルムが備えられており、半導体ウエハの裏面に保護膜形成用複合シートを貼付し、保護膜形成用フィルムを硬化させて保護膜とし、半導体ウエハを保護膜ごと分割して半導体チップとし、支持シートから引き離してピックアップするために用いられる保護膜形成用複合シート及び当該シートを用いた半導体チップの製造方法、が記載されている。
 ところで、帯電防止のために、帯電圧の半減期が20秒以下となるようにする技術は、例えば文献2、文献3に記載されているように周知であるから、係る周知技術を文献1に記載された発明に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求項2に係る発明は国際調査報告で引用した文献1-3より進歩性を有さない。
 最大帯電圧が1kV以下となるようにする技術は、例えば文献3に記載されているように周知であるから、係る周知技術を文献1に記載された発明に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求項4に係る発明は国際調査報告で引用した文献1-4より進歩性を有さない。

第V欄

新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明

帯電防止層の厚さを100nm以下とする技術は、例えば文献3、4に記載されているように周知であるから、係る周知技術を文献1に記載された発明に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求項5に係る発明は国際調査報告で引用した文献1-5より進歩性を有さない。

全光線透過率を80%以上とする技術は、例えば文献5に記載されているように周知であるから、係る周知技術を文献1に記載された発明に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求項6に係る発明は国際調査報告で引用した文献1-6に対して新規性、進歩性を有する。

文献1-6には、面積が2cm×2cmで平面状である押圧面を有する押圧手段の押圧面に、フランネル布を被せ、フランネル布を被せた押圧面を、帯電防止層の表面に押し当て、この状態で、押圧手段によって125g/cm²の荷重を帯電防止層に加えて押圧しながら、押圧手段を10cmの直線距離で10回往復運動させることにより、帯電防止層を擦った後、帯電防止層のこの擦った面のうち、面積が2cm×2cmの領域を目視観察したとき、傷が認められないことは記載されておらず、自明なものでもない。